

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 056 137 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
29.11.2000 Patentblatt 2000/48

(51) Int. Cl.⁷: **H01L 31/042**, H01L 31/05,
H01L 31/02, H01L 27/142

(21) Anmeldenummer: 00109681.7

(22) Anmeldetag: 06.05.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder: Just, Hilgarth
74360 Ilsfeld (DE)

(74) Vertreter:
Stoffregen, Hans-Herbert, Dr. Dipl.-Phys.
Patentanwalt,
Friedrich-Ebert-Anlage 11b
63450 Hanau (DE)

(30) Priorität: 11.05.1999 DE 19921545

(71) Anmelder:
Angewandte Solarenergie - ASE GmbH
63755 Alzenau (DE)

(54) **Solarzelle mit einer Schutzdiode und ihr Herstellungsverfahren**

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Solarzelle aufweist.

(26), die frontseitig eine integrierte Schutzdiode (28)

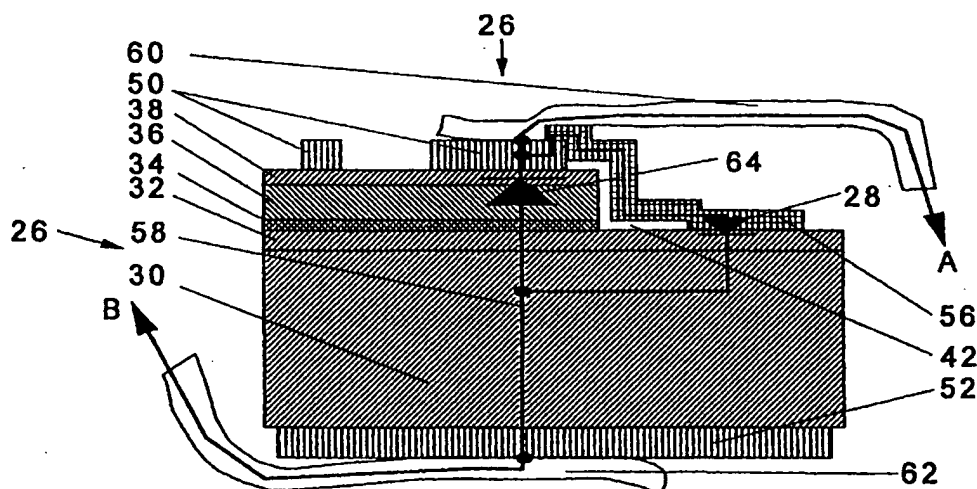


Fig. 7

EP 1 056 137 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Solarzelle mit integraler eine der Solarzelle entgegengerichteter Polarität aufweisender zumindest eine Diodenhalbleiterschicht umfassende Schutzdiode, wobei die Solarzelle zumindest einen Rückkontakt, ein Substrat als Träger für photoaktive zumindest eine frontseitige und eine substratseitige Schicht umfassende Schichten unterschiedlicher Polaritäten sowie einen Frontkontakt aufweist, und wobei die Schutzdiode in der Solarzelle integriert und solarzellenfrontseitig angeordnet ist. Ferner bezieht sich die Erfindung auf ein Verfahren zur Herstellung einer Solarzelle mit integraler eine der Solarzelle entgegengerichtete Polarität aufweisender zumindest eine Diodenhalbleiterschicht umfassender Schutzdiode, wobei die Solarzelle zumindest einen Rückkontakt, ein Substrat als Träger für photoaktive zumindest eine frontseitige und eine substratseitige Schicht umfassende Schichten unterschiedlicher Polaritäten sowie einen Frontkontakt aufweist, wobei Schichten insbesondere durch epitaktisches Wachsen ausgebildet werden.

[0002] In großflächigen Dioden von mehreren cm^2 -Flächen, wie diese Solarzellen aus Halbleitermaterial mit wenigstens einem p/n-Übergang bilden, sind Mikro-Kurzschlüsse, d. h. lokale, kleindimensionierte elektrische (ohmsche) Verbindungen über den p/n-Übergang des Halbleitermaterials oft unvermeidlich. Diese entstehen z. B. durch Oberflächenverletzungen während der Substratherstellung oder durch Dotierstoffanhäufungen z. B. an Kristallstörungen wie Versetzungen, insbesondere bei der Ausbildung von epitaxierten p/n-Übergängen bei z. B. Solarzellen der Elemente der Gruppen III-IV des Periodensystems.

[0003] Zwar stören die so entstehenden Mikro-Kurzschlüsse die Funktion der Diode als Solarzelle in Flussrichtung kaum oder nur in geringem Umfang. Die Fehlstellen können jedoch bei Betrieb der Zelle in Sperrrichtung zu einer Zerstörung der Zelle führen. Sind z. B. mehrere Solarzellen oder -generatoren seriell in einem sogenannten String auf einem Solar Array miteinander verbunden, so wird bei sperrendem p/n-Übergang eines Generators - dies kann durch Abschattung bewirkt werden - der Solarstrom von der hohen String-Spannung der restlichen beleuchteten Solarzellen oder -generatoren durch die ohmschen Mikro-Kurzschlüsse gepresst. Dies kann zu einer starken lokalen Erhitzung, Umdotierung zur Niederohmigkeit, d. h. lokaler starker Entartung des Halbleiters und letztendlich zur Zerstörung der Zelle selbst führen.

[0004] Zur Vermeidung entsprechender lokaler starker Erhitzungen, sogenannten Hot-Spots, ist es bei seriell geschalteten Solarzellen bekannt, parallel zu den Solarzellen liegende Schutzdioden anzuordnen, deren Flussrichtung entgegen der der Solarzellen verlaufen.

[0005] Bei Solarzellen-Strings, d. h. einem Verband von in Serie geschalteten Solarzellen oder Solar-

zellenmodulen können zur Erzielung einer höheren Zuverlässigkeit und der Vermeidung des Ausfalls ganzer Strings die einzelnen Solarzellen mit integralen Schutzdioden gesichert werden (siehe Lippold, Trogisch, Friedrich: Solartechnik, Berlin, Ernst, Verlag für Architektur u. Techn. Wiss. 1984, Seite 265, 266). Allerdings ist der zusätzliche Aufwand zur Verschaltung zu Strings entsprechender integraler Schutzdioden, die auf den Rückseiten der einzelnen Solarzellen vorgesehen sind, erheblich, da zusätzlich elektrisch leitende Verbindungen zur Solarzellenvorderseite angebracht werden müssen.

[0006] Eine Solarzelle der eingangs genannten Art ist der DE 38 26 721 A1 zu entnehmen. Zur Ausbildung der Schutzdiode ist es erforderlich, dass zunächst auf die photoaktive Schicht eine zusätzliche Schicht aus halbleitendem Material aufgebracht wird, die sodann bereichsweise weggeätzt wird.

[0007] Aus der US-Z.: J.M. Olson et al., "A 27.3% efficient $\text{Ga}_{0.5}\text{In}_{0.5}\text{P}/\text{GaAs}$ tandem solar cell", Appl.Phys.Lett. 56 (7), 1990, S. 623-625, ist eine Kaskadensolarzelle bekannt, bei der zwischen Paaren von photoaktive Zellen bildenden photoaktiven Schichten eine Tunnelodiode verläuft.

[0008] Der EP 0 327 023 A1 ist eine p-i-n-Solarzelle mit einer Schottky-Schutzdiode zu entnehmen.

[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine Solarzelle mit integraler Schutzdiode sowie ein Verfahren zur Herstellung einer solchen derart weiterzubilden, dass der herstellungstechnische Aufwand bei gleichzeitiger Erzielung einer hohen Zuverlässigkeit gering bleibt und die Verschaltung zu Strings keinen zusätzlichen Aufwand erfordert. Gleichzeitig soll die Ausbildung der Schutzdiode mit der Herstellung der Solarzelle selbst erfolgen.

[0010] Erfindungsgemäß wird das Problem durch eine Solarzelle dadurch gelöst, dass zwischen den stromerzeugenden photoelektrisch aktiven Schichten und dem frontseitigen Bereich des Substrats eine Tunnelodiode verläuft, die im unmittelbaren Bereich der Schutzdiode ausgespart ist, und dass bereichsweise frontseitiger Bereich des Substrats oder eine auf diesem aufgetragene oder aus diesem ausgebildete frontseitige Schicht mit einer frontseitiger photoaktiver Schicht entsprechenden Polarität die zumindest eine Diodenhalbleiterschicht der Schutzdiode ist.

[0011] Erfindungsgemäß wird die Diodenhalbleiterschicht bereichsweise von einer Schicht der Solarzelle selbst ausgebildet, wobei die photoaktiven Schichten beabstandet zu dem Bereich der Solarzelle verlaufen, der die Diodenhalbleiterschicht bildet. Ferner ist vorgesehen, dass die Schutzdiode mit ihrer Metallisierung in elektrisch leitendem Kontakt mit dem Frontkontakt verbunden ist.

[0012] In Weiterbildung der Erfindung ist die Schutzdiode gegenüber den photoaktiven Schichten der Solarzelle durch eine Isolatorschicht wie Antireflexionsschicht getrennt, entlang der sich die Metallisierung

der Schutzdiode bis hin zum Frontkontakt erstrecken kann. Alternativ besteht die Möglichkeit, dass die Schutzdiode mit einem elektrisch leitenden Verbinder verbunden ist, der mit dem von dem Frontkontakt der Solarzelle ausgehenden elektrisch leitenden Verbinder verbunden ist. Auch besteht die Möglichkeit, dass die Metallisierung der Schutzdiode einerseits mit dem Frontkontakt der Solarzelle verbunden ist und andererseits von der Metallisierung selbst ein Verbinder ausgeht, der seinerseits mit einer weiteren Solarzelle elektrisch leitend verbunden ist.

[0013] Die Schutzdiode selbst kann als eine Schottky-Diode, eine MIS-Kontakt-Diode, eine Diode mit p/n-Übergang oder als metalllegierte Diode ausgebildet sein.

[0014] Schottky-Dioden sind Halbleiter-Metallkontakte, die das Verhalten einer Diode aufweisen. Wird ein Metall in Kontakt mit einem nicht entarteten, d. h. niederdotierten z. B. n-leitenden Halbleiter gebracht, so kann eine elektrische Leitung nur einer Richtung erfolgen. Das Metall einer Grenzschicht zum Halbleiter wirkt in diesem Fall wie ein p-leitender Halbleiter, der zusammen mit dem n-Halbleiter eine Schottky-Diode bildet.

[0015] MIS-Kontakt-Dioden sind ähnlich der Schottky-Kontakte, wobei der Halbleiter und das Metall durch eine dünne Isolatorschicht getrennt sind, durch die Elektronen tunneln können. Vorteil entsprechender MIS-Kontakt-Dioden ist eine bessere Reproduzierbarkeit bei der Herstellung und eine verbesserte Temperaturstabilität.

[0016] Eine Diode mit p/n-Übergang entsteht durch Umdotierung der Polarisierung der Halbleiterschicht im Oberflächenbereich z. B. durch Implantation und/oder Eindiffusion eines entsprechenden Dotierstoffes zur Bildung eines lokalen Übergangs.

[0017] Metalllegierte Dioden-Kontakte sind Dioden, die durch Eindiffusion eines der Halbleiterdotierung entgegengesetzten Dotierstoffes aus dem Metallkontakt während der Sinterung oder des Legierens entstehen, wodurch ein p/n-Übergang im Halbleiter erzeugt wird.

[0018] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass zwischen den photoaktiven Schichten und dem frontseitigen Bereich des Substrats oder der Substratschicht mit der Polarität der frontseitigen photoaktiven Schicht die Tunnelndiode bildende Schichten verlaufen. Eine entsprechende Tunnelndiode ist zusätzlich dann vorgesehen, wenn der frontseitige Bereich des Substrats als photoaktiver Bereich ausgebildet ist, so dass durch die Tunnelndiode der substratseitig ausgebildete photoaktive Bereich von dem Bereich getrennt ist, aus dem die Diodenhalbleiterschicht ausgebildet ist. In diesem Fall sichert die Schutzdiode allerdings allein die frontseitige Solarzellendiode.

[0019] In Weiterbildung der Erfindung wird vorgeschlagen, dass die Solarzelle eine Kaskadensolarzelle aus mehreren übereinanderliegenden seriell durch Tunnelndioden verbundenen photoaktiven Schichten gleicher Polarität, z. B. Tandemsolarzelle mit ersten und

zweiten photoaktiven Schichten ist, dass zwischen den ersten frontseitigen und den zweiten substratseitigen photoaktiven Schichten eine erste Tunnelndiode und zwischen dem Substrat oder der auf diesem aufgetragenen oder ausgebildeten Schicht und den zweiten substratseitigen photoaktiven Schichten eine zweite Tunnelndiode verlaufen.

[0020] Weist das Material des Substrats gegenüber der frontseitig verlaufenden photoaktiven Schicht eine gleiche Polarität auf, so ist die eine der frontseitig verlaufenden photoaktiven Schicht entsprechende Polarität aufweisende und die Diodenhalbleiterschicht bildende Schicht bildender frontseitiger Bereich des Substrats oder die auf diesem aufgetragene oder aus diesem ausgebildete Schicht gleicher Polarität gegenüber dem Substrat über eine weitere Tunnelndiode getrennt.

[0021] Ein beispielhaftes Verfahren zur Herstellung einer Solarzelle mit integraler mit einer der Solarzelle entgegengerichteten Polarität aufweisenden zumindest eine Diodenhalbleiterschicht umfassenden Schutzdiode, wobei die Solarzelle zumindest einen Rückkontakt, ein Substrat als Träger für zumindest eine frontseitige und eine substratseitige photoaktive Schicht unterschiedlicher Polaritäten sowie einen Frontkontakt aufweist, und wobei Schichten insbesondere durch epitaktisches Wachsen ausgebildet sind, zeichnet sich durch die Verfahrensschritte aus:

- Aufbringen oder Ausbilden einer die zumindest eine Diodenhalbleiterschicht bildenden Zwischenhalbleiterschicht auf bzw. aus frontseitigem Bereich des Substrats einer Polarität entsprechend frontseitig photoaktiver Schicht der Solarzelle,
- Aufbringen oder Ausbilden einer Tunnelndiode auf bzw. aus der Diodenhalbleiterschicht,
- Aufbringen oder Ausbilden der substrat- und frontseitigen photoaktiven Schichten,
- bereichsweises Freilegen der Zwischenhalbleiterschicht und
- Ausbilden der Schutzdiode mit der der Solarzelle entgegengerichteten Polarität unter Verwendung freigelegten Bereichs der Zwischenhalbleiterschicht durch mittelbares oder unmittelbares Aufbringen einer Metallisierung auf diese und anschließendes Verbinden mit dem Frontkontakt.

[0022] Dabei ist insbesondere vorgesehen, dass vor dem bereichsweisen Freilegen der Zwischenhalbleiterschicht auf die frontseitige photoaktive Schicht der elektrische Frontkontakt ausgebildet wird.

[0023] Die Metallisierung der Schutzdiode wird unmittelbar mit dem Frontkontakt oder über einen von diesem ausgehenden elektrisch leitenden Verbinder

elektrisch leitend verbunden, der seinerseits mit weiteren Solarzellen verbunden wird.

[0024] Nach einer bevorzugten Ausbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass eine Stufe zwischen dem freigelegten Bereich der Zwischenhalbleiterschicht und den front- und substratseitigen photoaktiven Schichten ausgebildet wird, die mit einer vorzugsweise als Antireflexionsschicht wirkenden Isolierschicht versehen wird, entlang der zumindest bereichsweise die Metallisierung zu dem Frontkontakt hin verläuft.

[0025] Insbesondere ist vorgesehen, dass die Schutzdiode als Schottky-Diode, MIS-Kontaktdiode, p/n-Kontaktdiode oder metalllegierter Diodenkontakt ausgebildet wird.

[0026] Ein weiterer Vorschlag der Erfindung sieht vor, dass das Substrat frontseitig photoaktiv z.B. durch Eindiffusion eines p/n-Übergangs ausgebildet wird, dass auf ein Substrat die die Diodenhalbleiterschicht bildende Zwischenhalbleiterschicht gebildet wird, auf die die Tunnelodiode sowie die substrat- und frontseitigen Schichten aufgebracht werden.

[0027] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass auf eine erste Tunnelodiode erste und zweite und eventuell weitere photoaktive Schichtenpaare unterschiedlicher Polaritäten zur Bildung einer Kaskaden-Zelle aufgebracht werden, wobei zwischen den substratseitigen Schichten und den frontseitigen Schichten eine weitere Tunnelodiode angeordnet bzw. ausgebildet wird.

[0028] Erfindungsgemäß wird in der Frontseite einer Solarzelle oder -generators vorzugsweise bestehend aus Verbindungen der Gruppen III-V des Periodensystems eine Schutzdiode integral ausgebildet, wobei durch epitaktisches Wachsen von photoelektrisch aktiven und inaktiven Schichten auf einem Substrat, das selbst auch zur Erzeugung von Photostrom dien n kann, die Solarzelle selbst aufgebaut wird. Zur Ausbildung der Schutzdiode wird eine Schicht zwischen der eigentlichen photoaktiven Solarzelle und dem Substrat durch insbesondere epitaktisches Wachsen ausgebildet, die eine für Schottky-, MIS-, p/n- oder metalllegierte Diodenkontakte geeignete Schicht ist, die die gleiche Polarität wie die frontseitige photoaktive Schicht, also die oberste Schicht der Solarzelle aufweist. Bei entsprechender Polarität des Substrats verlaufen des Weiteren oberhalb der entsprechenden Schicht eine Tunnelodiode bildende Zwischenschichten.

[0029] Durch insbesondere lokales vertikales Abätzen eines flächenmäßig kleinen Bereichs der aktiven Solarzellenschichten und die Tunnelodiode bildenden Zwischenschichten wird die freigelegte als Diodenhalbleiterschicht dienende Zwischenhalbleiterschicht bereichsweise metallisiert, wodurch eine oberflächliche lokale Separierung derart erfolgt, dass sich eine auf die Fläche der Metallisierung begrenzte Diode ausbildet, die die umgekehrte Polarität zu der Zelle aufweist. Gegebenenfalls kann zur Ausbildung der gewünschten Diodenart (Schottky-Kontakt, MIS-Kontakt oder metall-

legierter Diodenkontakt) eine erforderliche Isolierung bzw. Diffusion zur Erzielung der gewünschten Übergänge erfolgen.

[0030] Losgelöst hiervon kann die Metallisierung der Diode über getrennte elektrisch leitende Verbinders mit dem Frontkontakt der Zelle oder unmittelbar durch gezielte Ausbildung der Kontaktmetallisierung mit diesem verbunden werden. Dieses kann dadurch erreicht werden, dass entlang der bei dem vertikalen Ätzen ausgebildeten Stufe zwischen den photoaktiven Schichten und der gegebenenfalls vorhandenen die Tunnelodiode bildenden Schichten und der die Diodenhalbleiterschicht bildenden Zwischenhalbleiterschicht verlaufenden Stufe eine Isolierschicht vorgesehen ist, entlang der sich die Kontaktmetallisierung zu dem Frontkontakt hin erstreckt. Durch diese Verschaltung ergibt sich eine zu der eigentlichen Solarzelle antiparallel verbundene integrierte Schutzdiode.

[0031] Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich nicht nur aus den Ansprüchen, den diesen zu entnehmenden Merkmalen - für sich und/oder in Kombination -, sondern auch aus der nachfolgenden Beschreibung von der Zeichnung zu entnehmenden bevorzugten Ausführungsbeispielen.

[0032] Es zeigen:

- | | |
|--------------|---|
| Fig. 1 | einen String von ausgeleuchteten Solarzellen, |
| Fig. 2 | einen String von Solarzellen, bei der eine Solarzelle abgeschattet ist, |
| Fig. 3 bis 7 | eine erfindungsgemäß ausgebildete Solarzelle in unterschiedlichen Herstellungsstufen, |
| Fig. 8 | eine zweite Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Solarzelle und |
| Fig. 9 | eine dritte Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Solarzelle. |

[0033] In den Fig. 1 und 2 ist rein prinzipiell ein String 10 von seriell verschalteten Solarzellen 12, 14, 16, 18 dargestellt, wobei in Fig. 1 sämtliche Solarzellen 12, 14, 16, 18 ausgeleuchtet sind. Demgegenüber ist bei dem in Fig. 2 dargestellten String 10 die Solarzelle 16 abgeschattet (Bezugszeichen 20).

[0034] Ein Solargenerator aus Halbleitermaterial mit wenigstens einem photoelektrisch aktiven p/n-Übergang der eigentlichen Solarzelle ist unbeleuchtet eine großflächige Diode, die rein beispielhaft mit dem Bezugszeichen 22 versehen ist. Wird die Solarzelle 12, 14, 16, 18 beleuchtet, wirkt diese wie ein Stromgenerator für Gleichstrom mit einem Solarstrom I_s , der der Intensität der Beleuchtung annähernd proportional ist und eine nahezu konstante Ausgangsspannung U_m aufweist, die der Flussspannung der jeweiligen Diode 22

entspricht, unter Abzug von Spannungs- und Stromverlusten aufgrund der inneren Widerstände.

[0035] In einem Solar-Array sind üblicherweise mehrere Zellen, im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 und 2 die Zellen 12, 14, 16, 18 seriell zu dem String 10 verbunden.

[0036] Durch einen String aus n gleichmäßig beleuchteten, gleichartigen, seriell verbundenen Zellen fließt der gleiche Strom I_s . Die annähernd gleiche Spannung U_m jeder Zelle der n -Zellen des Strings addiert sich zu einer Gesamtspanne $U_s = n \cdot U_m$ an den Enden des Strings.

[0037] In dem String 10 beleuchteter Zellen 12, 14, 18 wird die durch Abschattung 20 unbeleuchtete Zelle 16 zu der Diode 22, an der die Restspannung des Strings 10 in Sperrrichtung anliegt, um den erzeugten Solarstrom durchzupressen. Vorhandene Mikrokurzschlüsse in den aktiven Halbleiterschichten können bei Betrieb der Zelle 16 in Sperrrichtung zu deren Zerstörung führen. Schutz gegen entsprechende Zerstörungen bieten sogenannte Bypass- oder Schutzdioden 24. Entsprechende Schutzdioden 24 sind antiparallel mit dem p/n-Übergang der abgeschatteten Zelle 16 verbundene Dioden 24, die dann, wenn der p/n-Übergang der Zelle 16 sperrt, in Flussrichtung gepolt ist und den Strom, der bei einer Spannung $-U_d$, die der Kennlinie der Schutzdiode 24 in Flussrichtung bei dem Strom entspricht, durchlässt. Somit wird die Spannung U_r an den Enden des Strings durch die fehlende Spannung U_m der abgeschatteten Zelle (16) und die Flussspannung der Diode 24 $-U_d$ vermindert, so dass $U_r = U_s - U_m - U_d$ ist.

[0038] Im nicht abgeschatteten Zustand der Zelle 16 sperrt der p/n-Übergang der Schutzdiode 24 den Stromfluss durch diese bei einer Sperrspannung, die der Flussspannung der zugehörigen Solarzelle 16 entspricht.

[0039] Das Ausbilden entsprechender Schutzdioden 24 an sich für Solargeneratoren auf Solar-Arrays ist zwar bekannt, jedoch nur sehr aufwendig realisierbar.

[0040] Erfindungsgemäß werden nunmehr entsprechende Schutzdioden zusammen mit der Ausbildung der Solarzellen selbst hergestellt, wodurch sich eine verfahrensmäßige Vereinfachung bei gleichzeitiger verbesserter Schutzfunktion ergibt.

[0041] Anhand der Fig. 3 bis 9 soll die erfindungsgemäße Lehre näher erläutert werden, wobei dies am Beispiel einer Schottky-Diode als Schutzdiode erfolgt, ohne dass hierdurch eine Einschränkung erfolgen soll. Gleiches gilt in Bezug auf die Ausbildung der Solarzelle selbst sowie deren Materialien.

[0042] Die Fig. 3 bis 7 verdeutlichen prinzipiell den Verfahrensablauf zur Herstellung einer ersten Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Solarzelle 26, von der eine Schottky-Kontaktdiode 28 als Schutzdiode ausgebildet wird.

[0043] Auf einem photoelektrisch inaktiven Substrat

30 als Träger, das zum Beispiel aus n -leitendem einkristallinen Germanium besteht, wird zunächst eine geeignete niederdotierte Halbleiter-Schicht 32 zum Beispiel in Form von Galliumarsenid aufgebracht, das mit einem geeigneten Metall einen Schottky-Kontakt bilden kann. Dabei erfolgt die Ausbildung der niederdotierten Halbleiter-Schicht 32 vorzugsweise durch epitaktisches Wachsen. Vorzugsweise handelt es sich bei der Halbleiter-Schicht 32 um eine niederdotierte sogenannte Bufferschicht wie Galliumarsenid-Bufferschicht, die auch dem weiteren besseren epitaktischen Wachstum dient und die selbe Leitfähigkeit n wie das Substrat 30 aufweist. Auf die Bufferschicht 32 wird eine Halbleiter-Tunnel diode 34 epitaktisch aufgebracht, die aus zwei sehr hoch dotierten Schichten besteht, deren substratseitige Schicht n -dotiert und deren obere Schicht p -dotiert ist, um so einen niederohmigen Übergang zu einer sodann epitaktisch aufgebrachten p -leitenden Halbleiterschicht 36 zu bilden. Die p -leitende Halbleiterschicht 36 ist dabei substratseitige photoaktive Schicht oder Basis der eigentlichen Solarzellen. Sodann wird auf die p -leitende substratseitige Halbleiterschicht 36 eine n -leitende frontseitige Halbleiterschicht 38, der sogenannte Emitter aufgebracht, wodurch der p/n-Übergang zur Halbleiterschicht 36 oder Basis gebildet wird. Hierdurch sind im Beispiel der Fig. 3 die photoaktiven Schichten der Solarzelle komplettiert.

[0044] Erfindungsgemäß wird sodann ein im Vergleich zur photoempfindlichen Zellfläche kleiner Bereich der photoaktiven Schichten 38, 36, also des Emitters und der Basis sowie der Tunnel diode 34 durch zum Beispiel lokales vertikales Ätzen entfernt. Hierzu eventuell dienliche epitaktisch gewachsene photoelektrisch nicht aktive als Ätzstop-Schichten zu bezeichnende Schichten sowie andere dem besseren epitaktischen Wachstum oder der Erhöhung des photoelektrischen Wirkungsgrads dienende Epitaxieschichten wie zum Beispiel Fensterschichten oder sogenannte Cap-Schichten können den photoaktiven Schichten 36, 38, also der Basis und dem Emitter und damit der eigentlichen Solarzelle insoweit zugerechnet werden.

[0045] Durch das Entfernen wie Wegätzen der Schichten 36, 36, 34 bildet sich eine Stufe, eine sogenannte Ätzstufe 40 aus, die mit einer elektrisch isolierenden Schicht 42 abgedeckt wird. Diese Schicht 42 kann bei geeigneter Fertigungsfolge auch die zur Erhöhung des Lichteintritts in die Frontseite 44 der Solarzelle 26 üblicherweise aufgebrachte nicht leitende Antireflexionsschicht sein. Wie die Fig. 4 - 7 verdeutlichen, erstreckt sich die Isolierschicht 42 sowohl entlang der Oberfläche der als Diodenhalbleiterschicht geeigneten Zwischenhalbleiterschicht 32 und der freien Außenfläche 46 der frontseitigen Halbleiterschicht 38 oder des Emitters als auch entlang der im Ausführungsbeispiel senkrecht zu den von den Schichten 32 und 38 gespannten Ebenen verlaufenden freigeätzten Randflächen 48 der Tunnel diode 34, der p -leitenden Basis 36 und des n -leitenden Emitters 38.

[0046] In einem sich anschließenden Verfahrensschritt werden sodann auf der Vorderseite 46 der photoaktiven Schicht 38 und damit der Solarzelle 26 und rückseitig auf dem Substrat 30 elektrisch leitende Front- und Rückseitenkontakte 50, 52 aufgebracht, die zur Entnahme des Solarstroms der Zelle 26 dienen.

[0047] Zur Ausbildung der als Schutzdiode dienenden Schottky-Diode 28 wird bereichsweise auf den freigelegten Bereich 54 der im Ausführungsbeispiel niederdotierten Zwischenhalbleiterschicht 32 in Form der epitaktisch aufgewachsenen Galliumarsenid-Buffererschicht eine für einen Schottky-Kontakt geeignete Metallisierung 56 aufgebracht. Dabei ist die Metallisierung 56 in ihrer Flächenerstreckung derart gewählt, dass sich diese über die isolierte Ätzstufe, also die Beschichtung 42 zum Frontkontakt 50 hin erstreckt und damit die erforderliche elektrisch leitende Verbindung herstellt. Mit dieser Maßnahme wird die Schottky-Kontaktdiode 28 mit dem p/n-Übergang der Solarzelle 26 entgegengesetzter Polarität erzeugt, wobei gleichzeitig die elektrische Ankopplung der Schutzdiode 28 an die Solarzelle 26 selbst erfolgt.

[0048] In der vergrößerten Darstellung der Solarzelle 26 in Fig. 7 ist ein Stromlaufplan 58 der Solarzelle 26 eingezeichnet, wobei ergänzend elektrisch leitende Verbinder 60, 62, die von dem Frontkontakt 50 und dem Rückseitenkontakt 52 ausgehen, dargestellt sind, um die Solarzelle 26 mit der integrierten Schutzdiode 28 mit weiteren entsprechend aufgebauten Zellen zu einem String zu verschalten. Dabei geht der Verbinder 60 zu einem Rückseitenkontakt einer vorhergehenden Solarzelle A und der Verbinder 62 zu einem Frontkontakt einer nachfolgenden Solarzelle B.

[0049] Ferner ist dem Stromlaufplan 58 und dem dargestellten Ersatzschaltbild zu entnehmen, dass die Schutzdiode 28 antiparallel zu der durch die photoaktiven Schichten 36, 38 gebildeten Diode 64 geschaltet ist, die die eigentliche Solarzelle bildet.

[0050] Sollte anstelle einer Schottky-Diode als Schutzdiode 28 eine MIS-Kontakt-Diode zum Einsatz gelangen, so würde zwischen der im Ausführungsbeispiel n-leitenden Zwischenhalbleiterschicht 32 und der Metallisierung 56 eine geeignete Isolatorschicht angeordnet werden. Sofern eine metalllegierte Diode als Schutzdiode 28 benutzt werden soll, wird eine geeignete Metallkomposition als Kontaktmaterial mit nachfolgendem Sintern oder Legieren verwendet.

[0051] Auch besteht die Möglichkeit, lokal einen p/n-Übergang zu erzeugen.

[0052] Die entsprechenden als Schutzdioden ausgebildeten Diodenarten können auch in Varianten des anhand der Fig. 3 - 7 erläuterten Solargenerators 26 zur Anwendung gelangen. Eine Variante ist zum Beispiel die Umkehrung aller Dotierungspolaritäten.

[0053] Weitere Beispiele von Modifikationen am Aufbau von Solarzellen bzw. -generatoren und dem Einsatz von Schutzdioden sollen anhand der Fig. 8 und 9 erläutert werden, ohne dass hierdurch eine Einschränkung

kung der Erfindung erfolgt. Dabei werden für gleiche Elemente grundsätzlich gleiche Bezugszeichen verwendet.

[0054] Eine in der Fig. 8 dargestellte Solarzelle 68 weist ein Substrat 70 auf, das abweichend zu dem Substrat 30 der Solarzelle 26 eine entgegengesetzte Dotierungspolarität aufweist, also aus p-leitendem Material besteht. Auf dem Substrat 70 kann eine Bufferschicht 72 gleicher Leitungsart p aufgebracht sein. Da die Solarzelle 68 in Bezug auf ihre photoaktiven Schichten gleiche Polarität aufweist wie die Solarzelle 26, muss zwischen einer die Dioden-Halbleiterschicht bildenden n-leitenden Zwischenhalbleiterschicht 74 und dem Substrat 70 bzw. dessen frontseitiger Schicht 72 eine Tunnel diode 76 ausgebildet werden, um einen niederohmigen Stromdurchgang zum Substrat 70 bzw. der Bufferschicht 72 sicherzustellen. Die Tunnel diode 76 weist dabei einen Schichtaufbau auf, der umgekehrt zu dem der Tunnel diode 34 ist, also substratseitig p-dotiert und frontseitig n-dotiert ist. Auf die so ausgebildeten Substrat- und Bufferschichten 70, 72, Tunnel diode 76 und Zwischenhalbleiterschicht 74 werden sodann zur Bildung von übereinander angeordneten photoaktiven Zellen erste und zweite Paare von Schichten 78, 80 und 82, 84 insbesondere epitaktisch aufgewachsen, wobei die Schichten 78, 82 p-leitende Halbleiterschichten und die Schichten 80, 84 n-leitende Halbleiterschichten sind, um hierdurch jeweils einen p/n-Übergang zwischen dem jeweiligen Emitter 80, 84 und der Basis 78, 82 auszubilden. Ferner werden zwischen dem unteren Schichtpaar 78, 80, also der Basis 78 und der Zwischenhalbleiterschicht 74 eine Tunnel diode 86 und zwischen den ersten und zweiten Paaren der Schichten, also zwischen dem Emitter 80 und der Basis 82, eine weitere Tunnel diode 88 ausgebildet, deren jeweilige Schichten Polaritäten aufweisen, wie diese der Tunnel diode 34 der Solarzelle 26 entspricht, also frontseitig p-dotiert und substratseitig n-dotiert.

[0055] Sodann wird entsprechend der Verfahrensweise nach den Fig. 3 - 7 durch insbesondere lokales vertikales Ätzen die Zwischenhalbleiterschicht 76, die die für die Schutzdiode 28 notwendige Diodenhalbleiterschicht bildet, freigelegt, um durch lokales Aufbringen einer Metallisierung 90 den gewünschten Schottky-Kontakt als die gewünschte Schutzdiode 28 auszubilden. Von der Metallisierung 90 geht im vorliegenden Fall ein elektrisch leitender Verbinder 52 aus, der mit dem elektrisch leitenden Verbinder 60 verbunden ist, der seinerseits von dem Frontkontakt 50 der Solarzelle 68 ausgeht. Durch die diesbezügliche Ausgestaltung ist es nicht erforderlich, dass sich entlang der durch das vertikale Ätzen ausgebildeten Stufe 40 eine Isolierschicht erstreckt.

[0056] Wie der in die Solarzelle 68 eingezeichnete Stromlaufplan 94 mit Ersatzschaltbild belegt, schützt die Schutzdiode 28 die von den photoaktiven Schichten 78, 80 und 82, 84 gebildeten zwei Dioden 96, 98.

[0057] Eine in der Fig. 9 prinzipiell dargestellte

Solarzelle 100 unterscheidet sich von der der Fig. 7 dahingehend, dass in ein Substrat 102 ein p/n-Übergang 104 eindiffundiert ist, um ebenfalls zur Erzeugung von Strom benutzt zu werden. In zuvor beschriebener Weise erstreckt sich darauf eine Zwischenhalbleiterschicht 108 als Diodenhalbleiterschicht, auf die wiederum eine Tunnel diode 110 und sodann weitere photoaktive Schichten 112, 114 aufgebracht werden, die einen p/n-Übergang bilden. Sodann werden die photoaktiven Bereiche 114, 112, also der Emittor und die Basis sowie die Tunnel diode 110 lokal weggeätzt, so dass die Zwischenhalbleiterschicht 108 freigelegt wird. Die hierdurch ausgebildete Ätzstufe 40 wird entsprechend der Fig. 7 mit der Isolierschicht 42 abgedeckt. Die sodann aufzubringenden Frontkontakte 116 weisen in Bezug auf die Solarzelle 26 der Fig. 7 eine abweichende Anordnung derart auf, dass diese bereichsweise entlang der Isolierschicht 42 verlaufen. Sodann wird auf einen freigelegten Bereich der Zwischenhalbleiterschicht 108 die erforderliche Metallisierung 118 aufgebracht, die sich bis zu dem entlang der Isolierschicht 42 verlaufenden Frontkontaktmaterial erstreckt, so dass sich die erforderliche elektrisch leitende Verbindung ergibt. Ein elektrisch leitender Verbindender 120 geht sodann von der Metallisierung 118 aus, um mit dem Rückkontakt einer vorausgehenden Solarzelle A verbunden zu werden. Da der Frontkontakt 116 mit der Metallisierung 118 unmittelbar verbunden ist, braucht von dem Frontkontakt 116 selbst kein entsprechender Verbindender 120 auszugehen. Von dem Rückkontakt 52 geht entsprechend dem zuvor erläuterten Ausführungsbeispiel der weitere Verbindender 62 aus, der zur Frontseite einer nachfolgenden Solarzelle führt. Nachfolgende und vorangehende Solarzellen oder -generatoren sind selbstverständlich relativ zu verstehen.

[0058] Wie der Stromlaufplan 122 für die Zelle 100 belegt, schützt die Schutzdiode 28 allein die aus den photoaktiven Schichten 112, 114 gebildete Diode 124 und nicht den photoaktiven Bereich, der durch die innerhalb des Substrats 102 eingezeichnete Diode 126 gebildet wird.

[0059] Zweckmäßigerweise sollten die erfindungsgemäßen Zellen derart geometrisch ausgebildet sein, dass die Schutzdiode 28 in der Nähe von Befestigungspunkten der Verbindender, die zu den anderen Zellen führen, oder in der Nähe von Stromsammelbalken des Frontkontaktes verlaufen, sofern sie nicht selbst zu denselben ausgebildet sind, um zusätzliche Verluste aktiver Zellflächen durch Metallzuleitungen zwischen den Schutzdioden 28 und den Frontkontakten zu vermeiden.

[0060] Auch ist anzumerken, dass bei größeren Zellen mehr als eine Schutzdiode ausgebildet werden kann.

Patentansprüche

1. Solarzelle (28, 68, 100) mit integraler einer der Solarzelle entgegengerichteter Polarität aufweisender zumindest eine Diodenhalbleiterschicht (32, 76, 108) umfassende Schutzdiode (28), wobei die Solarzelle zumindest einen Rückkontakt (52), ein Substrat (30, 70, 102) als Träger für photoaktive zumindest eine frontseitige und eine substratseitige Schicht umfassende Schichten (36, 38; 78, 80; 82, 84; 112, 114) unterschiedlicher Polaritäten sowie einen Frontkontakt (50, 116) aufweist, und wobei die Schutzdiode in der Solarzelle integriert und solarzellenfrontseitig angeordnet ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass zwischen den stromerzeugenden photoelektrisch aktiven Schichten (36, 38, 78, 80, 112, 114) und dem frontseitigen Bereich des Substrats (30, 70, 102) eine Tunnel diode (34, 86, 110) verläuft, die im unmittelbaren Bereich der Schutzdiode (28) ausgespart ist, und dass bereichsweise frontseitiger Bereich des Substrats (30, 70, 102) oder eine auf diesem aufgetragene oder aus diesem ausgebildete frontseitige Schicht (32, 74, 108) mit einer frontseitiger photoaktiver Schicht (38, 80, 84, 114) entsprechenden Polarität die zumindest eine Diodenhalbleiterschicht der Schutzdiode (28) ist.
2. Solarzelle nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass der die zumindest eine Diodenhalbleiterschicht (32, 76, 108) bildende Bereich der Schutzdiode (28) beabstandet zu den photoaktiven Schichten (36, 38, 78, 80, 82, 84, 104, 112, 114) verläuft, wobei insbesondere die Schutzdiode (28) eine Schottky-Diode, MIS-Kontakt-Diode, p/n-diffundierte Kontakt-Diode oder Metalllegierungs-Kontakt-Diode ist.
3. Solarzelle nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass die photoaktiven Schichten (36, 38, 112, 114) der Solarzelle (26, 100) gegenüber der Schutzdiode (28) bzw. deren Metallisierung (56, 118) durch eine elektrisch isolierende Schicht wie Antireflexionsschicht (42) getrennt sind und dass vorzugsweise sich entlang der elektrisch isolierenden Schicht (42) zumindest abschnittsweise die Metallisierung (56, 118) der Schutzdiode (28) erstreckt und/oder sich die Metallisierung (56) der Schutzdiode (28) entlang der elektrisch isolierenden Schicht (42) bis hin zu dem Frontkontakt (50) der Solarzelle (26) erstreckt.
4. Solarzelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass sich der Frontkontakt (116) der Solarzelle

- (100) bereichsweise entlang der elektrisch isolierenden Schicht (42) erstreckt und unmittelbar mit der Metallisierung (118) der Schutzdiode (28) verbunden ist und/oder dass von dem Frontkontakt (50) und/oder der Metallisierung (90, 118) ein elektrisch leitender Verbinder (60, 92, 120) ausgeht, der zu einem Rückkontakt einer weiteren Solarzelle führt.
5. Solarzelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Solarzelle (68) eine Kaskadensolarzelle mit wenigstens ersten frontseitigen und zweiten substratseitigen photoaktiven Schichten (82, 84, 78, 80) ist und dass zwischen den zweiten substratseitigen photoaktiven Schichten und dem Substrat (70) die die Diodenhalbleiterschicht bildende Zwischenhalbleiterschicht (72) der der frontseitigen photoaktiven Schicht entsprechenden Polarität verläuft, wobei zwischen photoaktive Zellen bildenden Paaren photoaktiven Schichten (82, 84; 78, 80) jeweils einer Tunnelodiode (88) angeordnet ist.
6. Solarzelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass bei einem Substrat (70) einer zu der Polarität der photoaktiven frontseitigen Schicht (84) entgegengesetzten Polarität zwischen der die Diodenhalbleiterschicht bildenden Zwischenhalbleiterschicht (74) und dem Substrat eine Tunnelodiode (76) verläuft.
7. Solarzelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Substrat (102) der Solarzelle (100) in seinem frontseitigen Bereich einen p/n-Übergang (104) aufweist, über den sich die die Diodenhalbleiterschicht bildende Zwischenhalbleiterschicht (108) erstreckt, auf der außerhalb der Schutzdiode (28) eine zweite Tunnelodiode (118) und die auf dieser angeordneten photoaktiven Schichten (112, 114) angeordnet sind.
8. Verfahren zur Herstellung einer Solarzelle mit integraler eine der Solarzelle entgegengerichtete Polarität aufweisender zumindest eine Diodenhalbleiterschicht umfassender Schutzdiode, wobei die Solarzelle zumindest einen Rückkontakt, ein Substrat als Träger für photoaktive zumindest eine frontseitige und eine substratseitige Schicht umfassende Schichten unterschiedlicher Polaritäten sowie einen Frontkontakt aufweist, wobei Schichten insbesondere durch epitaktisches Wachsen ausgebildet werden, **gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte:**
- Aufbringen oder Ausbilden einer die zumindest eine Diodenhalbleiterschicht bildenden Zwischenhalbleiterschicht auf bzw. aus frontseitigem Bereich des Substrats einer Polarität entsprechend frontseitiger photoaktiver Schicht der Solarzelle,
 - Aufbringen oder Ausbildung einer Tunnelodiode auf bzw. aus der Zwischenhalbleiterschicht,
 - Aufbringen oder Ausbilden der substrat- und frontseitigen photoaktiven Schichten,
 - bereichsweises Freilegen der Zwischenhalbleiterschicht,
 - Ausbilden der Schutzdiode mit der der Solarzelle entgegengerichteten Polarität unter Verwendung von freigelegtem Bereich der Zwischenhalbleiterschicht durch mittelbares oder unmittelbares Aufbringen einer Metallisierung auf dieser und anschließendes Verbinden mit dem Frontkontakt.
9. Verfahren nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass insbesondere nach dem bereichsweise Freilegen der Zwischenhalbleiterschicht auf der frontseitigen photoaktiven Schicht der elektrisch leitende Frontkontakt angeordnet wird, dass vorzugsweise die Metallisierung unmittelbar mit dem Frontkontakt oder über einen von diesem ausgehenden elektrisch leitenden Verbinder elektrisch leitend verbunden ist, der mit rückseitigem Kontakt einer weiteren Solarzelle verbunden wird, und/oder dass zwischen dem freizulegenden Bereich der Zwischenhalbleiterschicht und den front- und substratseitigen photoaktiven Schichten eine Stufe insbesondere durch vertikales Ätzen ausgebildet wird.
10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass entlang der Stufe eine sich von der frontseitigen photoaktiven Schicht bis zu dem freigelegten Bereich der Zwischenhalbleiterschicht erstreckende elektrisch isolierende Schicht wie Antireflexionsschicht ausgebildet wird.
11. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 8 - 10, **dadurch gekennzeichnet**, dass in dem Substrat frontseitig ein p/n-Übergang ausgebildet wird, auf dem sich die Zwischenhalbleiterschicht erstreckt.
12. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 8 - 11, **dadurch gekennzeichnet**, dass auf die Zwischenhalbleiterschicht mehrere Paare von photoaktiven Schichten aufgebracht werden, wobei jeweils zwischen den Paaren von photoaktiven Schichten eine Tunnelodiode verläuft,

und dass vorzugsweise zur Ausbildung der die Tunnel-diode bildenden Schichten und/oder der photo-aktiven Schichten und/oder der Zwischenhalbleiterschicht diese durch epitaktisches Wachsen hergestellt werden.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

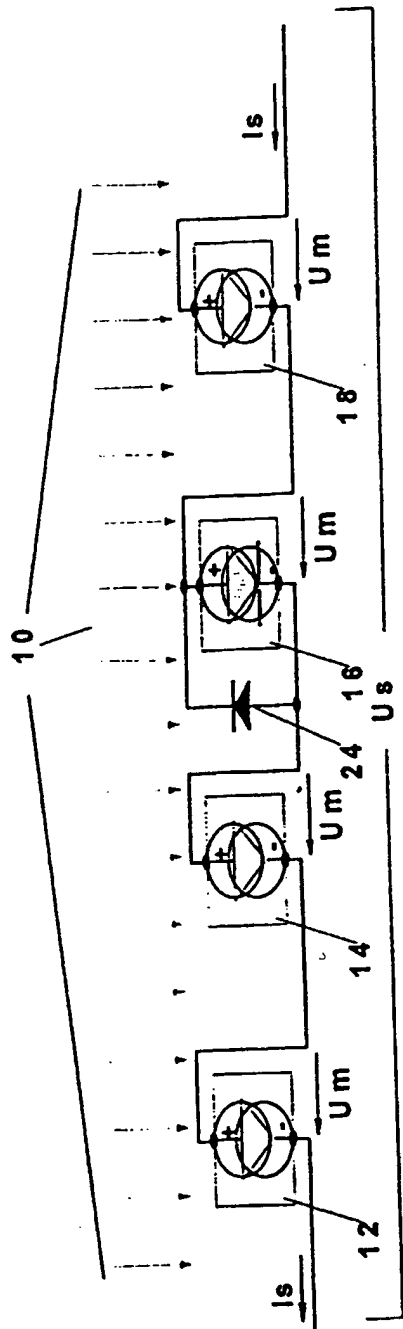


Fig. 1

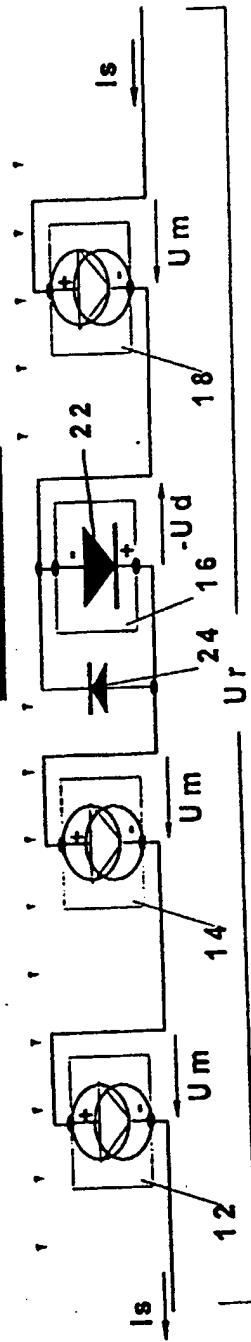


Fig. 2

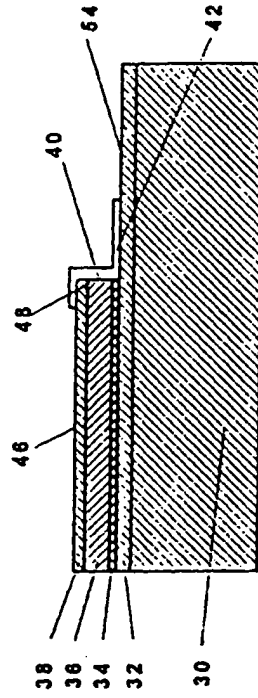


Fig. 3

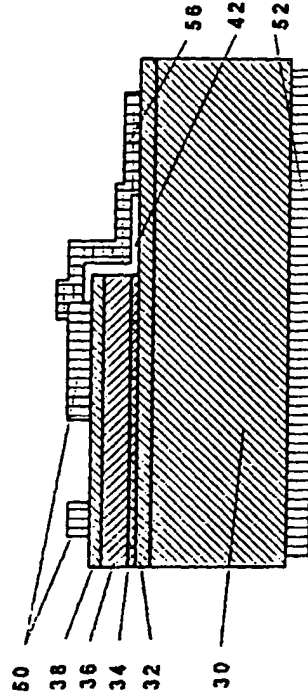


Fig. 4

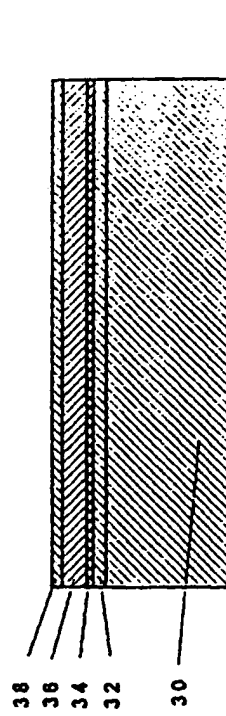


Fig. 5

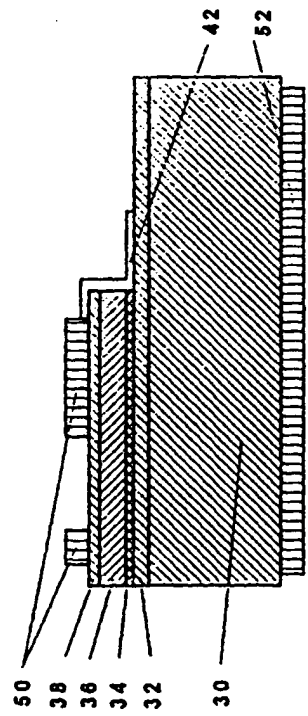


Fig. 6

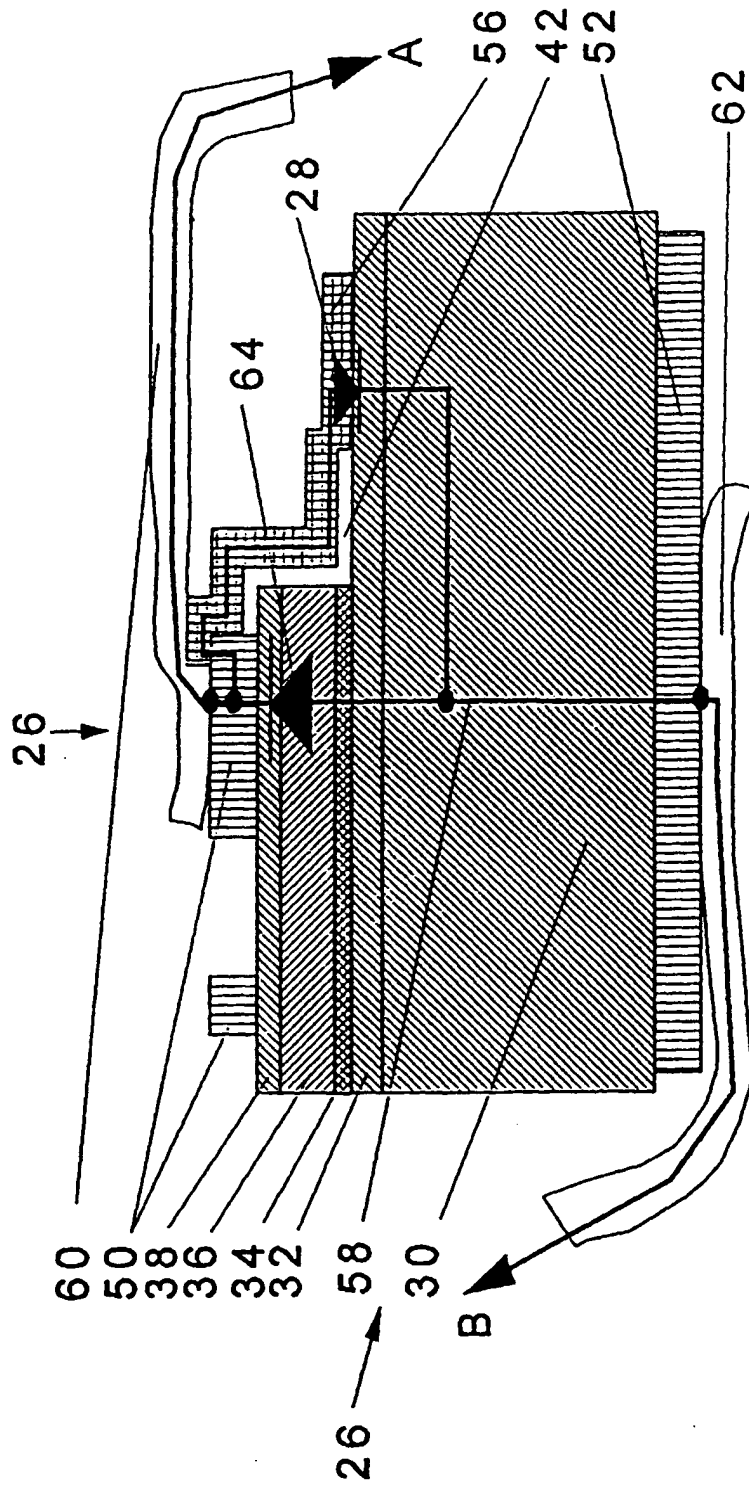


Fig. 7

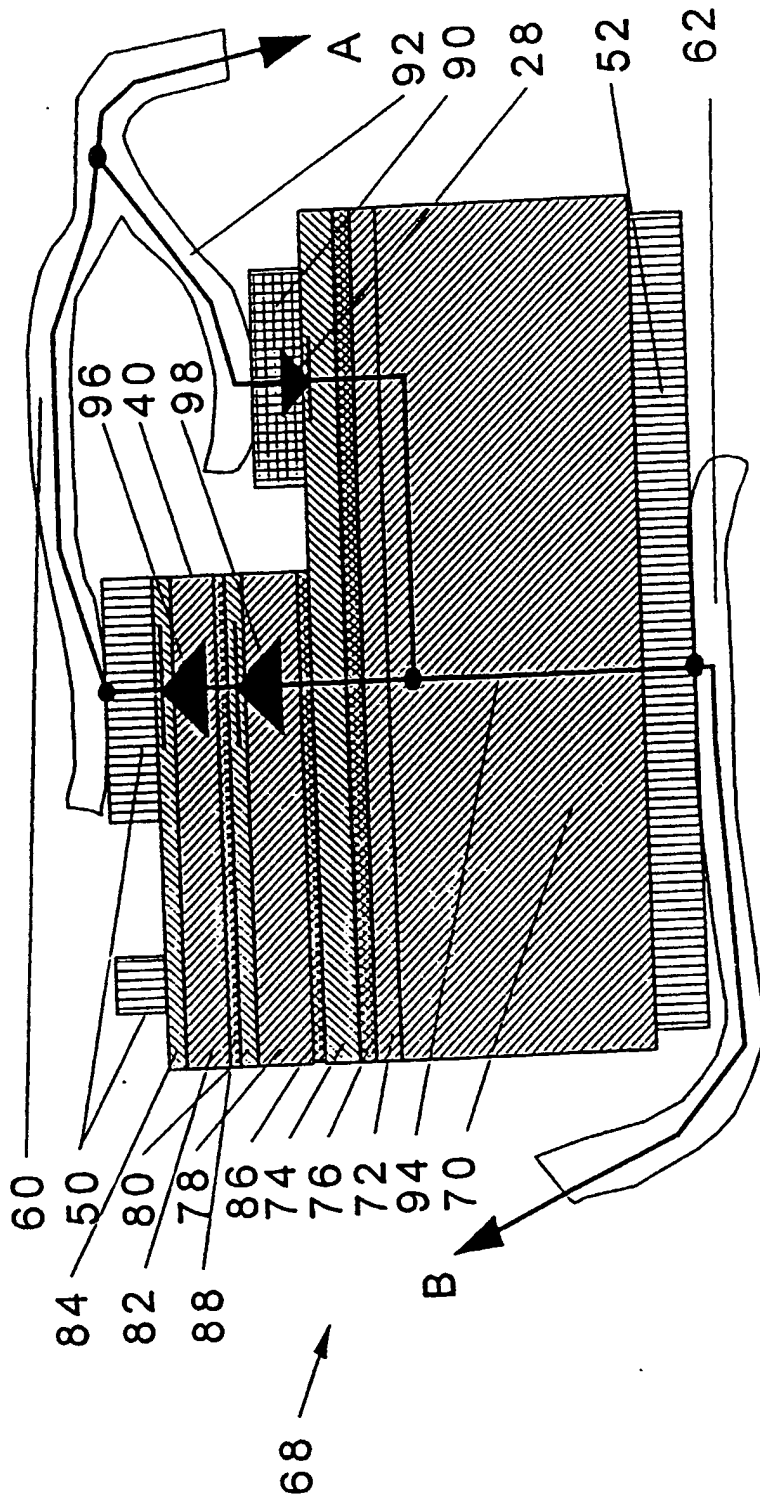


Fig. 8

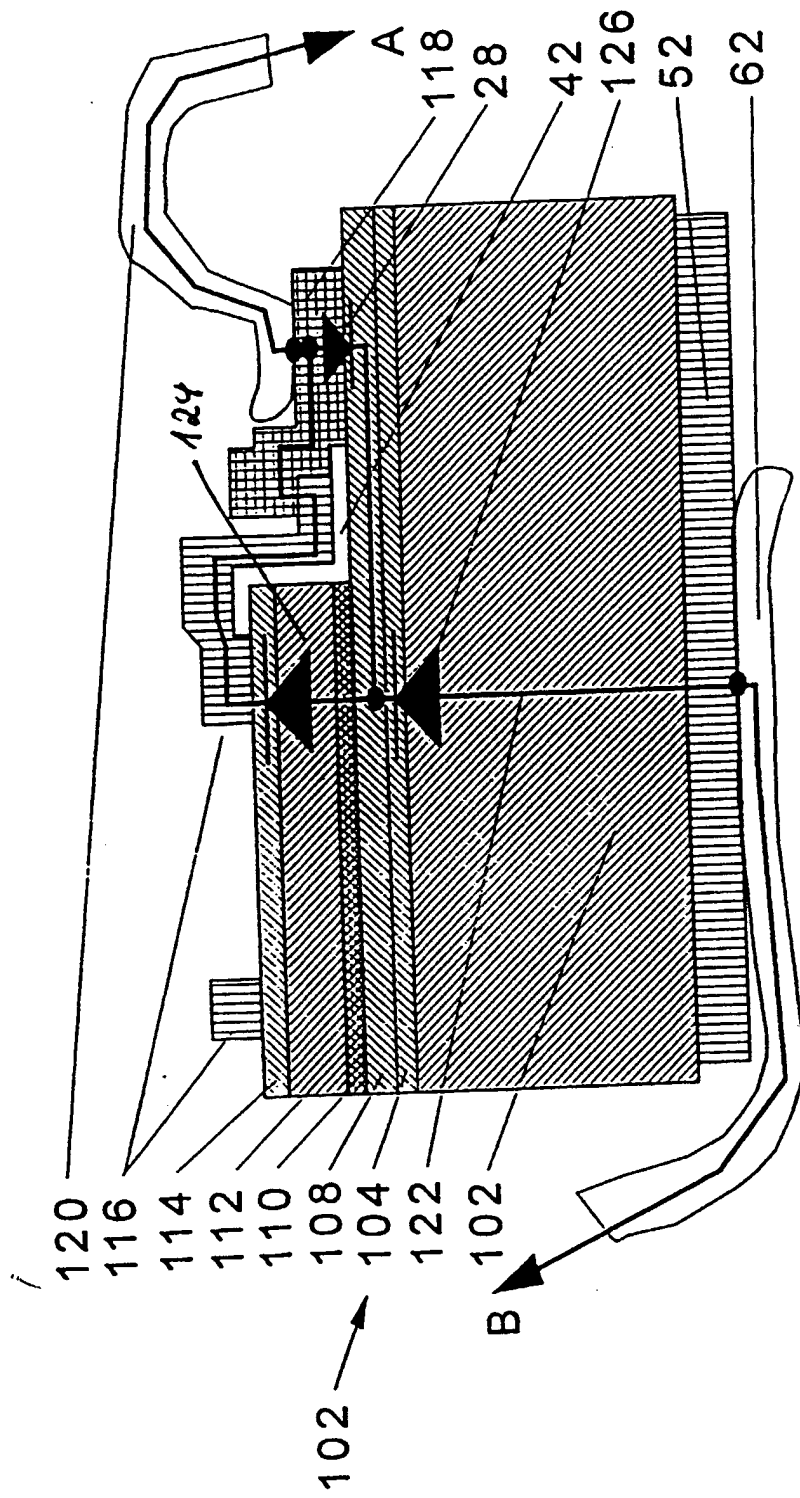


Fig. 9



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 00 10 9681

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
Y	US 4 997 491 A (HOKUYO SHIGERU ET AL) 5. März 1991 (1991-03-05) * das ganze Dokument *	1-12	H01L31/042 H01L31/05 H01L31/02 H01L27/142
Y	US 5 223 043 A (OLSON JERRY M ET AL) 29. Juni 1993 (1993-06-29) * das ganze Dokument *	1-12	
D,A	DE 38 26 721 A (AMERICAN CYANAMID CO) 16. Februar 1989 (1989-02-16) * Zusammenfassung; Abbildung 9 *	1	
P,X	WO 99 62125 A (TECSTAR POWER SYSTEMS INC ;CHU CHAW LONG (US); HO FRANK (US); ILES) 2. Dezember 1999 (1999-12-02) * Ansprüche 24,25; Abbildung 14B *	1,8	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			H01L
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort MÜNCHEN		Abschlußdatum der Recherche 28. Juli 2000	Prüfer Werner, A
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur δ : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.02 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 10 9681

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

28-07-2000

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 4997491 A	05-03-1991	JP 2135786 A	24-05-1990
		DE 68917428 D	15-09-1994
		DE 68917428 T	22-12-1994
		DE 68923061 D	20-07-1995
		DE 68923061 T	09-11-1995
		EP 0369666 A	23-05-1990
		EP 0369717 A	23-05-1990
		US 5009720 A	23-04-1991
US 5223043 A	29-06-1993	KEINE	
DE 3826721 A	16-02-1989	US 4759803 A	26-07-1988
		FR 2619248 A	10-02-1989
		GB 2208036 A,B	15-02-1989
		JP 2090573 A	30-03-1990
WO 9962125 A	02-12-1999	AU 4193899 A	13-12-1999
		EP 1008188 A	14-06-2000

EPO FORM P441

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82